Московский физико-технический институт

Лабораторная работа

Измерение контактной разности потенциалов в полупроводниках

выполнила студентка 653 группы ФФКЭ Карпова Татьяна

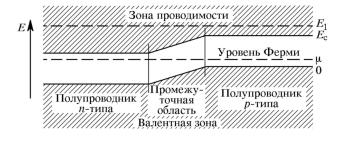
1 Цель работы

Определение контактной разности потенциалов (p-n)-перехода в полупроводниковом диоде по результатам измерений температурной зависимости его сопротивления

2 Физическая суть явления

В работе исследуется явление контактной разности потенциалов, возникающее на контакте электронного и дырочного полупроводников. Для создания такого контакта в полупроводник вводятся как донорная, так и акцепторная примеси. В одной части образец содержит доноры (обладает электронной электропроводностью), а в другой части - акцепторы (обладает дырочной электропроводностью), соответственно, в некоторой области кристалла происходит смена характера электропроводности, или так называемый (p-n)-переход.

При приведении полупроводников n- и p- типа в соприкосновение друг с другом сначала вблизи границы перехода будет существовать большой градиент концентрации электронов и дырок, в результате чего начнётся диффузия электронов из n-области в p-область и дырок из p-области в n-область. Возникновение диффузионных потоков приведёт к разделению зарядов и появлению положительного объёмного заряда в p-области (положительные ионы донорной примеси) и отрицательного объёмного заряда в p-области (отрицательные ионы акцепторной примеси), и в области (p-n)-перехода образуется слой, обеднённый носителями тока. Эти объёмные заряды в области контакта создадут сильное электрическое поле, направленное от n-области к p-области и препятствующее движению электронов и дырок - возникнет контактная разность потенциалов. В результате установится равновесное состояние, уровень Ферми для всего полупроводника будет постоянным, а в области перехода, где имеется электрическое поле, зоны энергии будут искривлены (см. рис. 1)



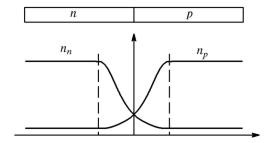


Рис. 1: Энергетическая схема (p-n)-перехода, находящегося в равновесии

Рис. 2: Концентрация электронов и дырок в области (p-n)-перехода

В области (p-n)-перехода уровень Ферми проходит вдалеке как от валентной зоны, так и от зоны проводимости, поэтому эта область бедна как электронами, так и дырками и обладает большим электрическим сопротивлением (см. рис. 2). Переход неосновных носителей заряда через потенциальный барьер совершается под действием электрического поля (p-n)-перехода. В состоянии термодинамического равновесия плотность диффузионного потока основных носителей заряда уравновешена плотностью дрейфового тока неосновных носителей заряда и суммарный ток через (p-n)-переход равен нулю.

K(p-n)-переходу может быть также приложена разность потенциалов такая, что p-область заряжается положительно относительно n-области (прямое, или положительное, смещение) или отрицательное (обратное, или отрицательное, смещение) (см. рис. 3 а и 6). Основное падение напряжения приходится на область (p-n)-перехода (он обладает большим сопротивлением).

В первом случае (положительное смещение) высота потенциального барьера понижается по сравнению с равновесным состоянием, это приводит к увеличению потока основных носителей заряда по сравнению с равновесным состоянием, в то время как поток неосновных носителей заряда через переход остаётся практически неизменным, в результате этого во внешней цепи будет протекать прямой ток. Аналогичные рассуждения можно отнести и к дыркам. Таким образом, увеличение положительного смещения приводит к сильному росту тока через контакт в прямом направлении.

Если к (p-n)-переходу приложено отрицательное смещение, потенциальный барьер понижается. Чем сильнее смещён переход в обратном направлении, тем меньшее количество основных носителей заряда способно преодолеть возросший потенциальны барьер. Ток основных носителей заряду уменьшается, ток неосновных носителей заряда остаётся постоянным. Поэтому суммарный ток через (p-n)-переход будет направлен от n-области к p-области и с увеличением обратного напряжения будет сначала незначительно расти, а затем стремиться к некоторой величине, называемой током насыщения.

Таким образом, (p-n)-переход имеет нелинейную BAX (см. рис. 4) и может использоваться для выпрямления тока.

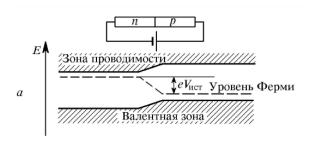


Рис. 3: Схема (*p-n*)-перехода под напряжением: положительное смещение

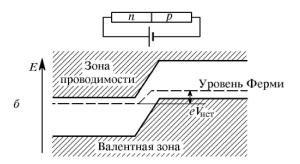


Рис. 4: Схема (p-n)-перехода под напряжением: отрицательное смещение



Рис. 5: Вольт-амперная характеристика (p-n)-перехода

3 Теоретические положения

Оценим разность потенциалов, возникающую в области (p-n)-перехода. При равной концентрации акцепторов и доноров смещение уровня Ферми вверх в n-области равно смещению этого уровня вниз в p-области. Тогда разность потенциалов в области перехода равна

$$e\triangle V = 2(\mu - \frac{1}{2}E_c),\tag{1}$$

где μ - положение уровня Ферми, $\frac{1}{2}E_c$ определяет несмещённое положение уровня Ферми. Плотности электронов и дырок в зоне проводимости будут равны соответственно

$$n_n = Q_n \exp(-\frac{E_c - \mu}{k_B T}) \tag{2}$$

(определяется плотностью электронов с донорных уровней), и

$$n_p = Q_p \exp(-\frac{\mu}{k_B T}) \tag{3}$$

(определяется плотностью электронов, перешедших под действием теплового возбуждения из валентной зоны в зону проводимости). Тогда

$$\frac{n_n}{n_p} = \exp(\frac{2\mu - E_c}{k_B T}) = \exp(\frac{e\triangle V}{k_B T}),\tag{4}$$

искомая разность потенциалов равна

$$\Delta V = \frac{k_B T}{e} \ln \frac{n_n}{n_p} \tag{5}$$

Из-за наличия потенциального барьера между концентрациями основных и неосновных носителей заряда в n- и p-областях устанавливается следующее соотношение:

$$\frac{n_n(n)}{n_n(p)} = \frac{n_p(n)}{n_p(p)} = \exp(\frac{e\triangle V}{k_B T}) \tag{6}$$

В условиях равновесия токи равновесных и неравновесных зарядов равны друг другу:

$$I_0 \propto n_n(p) = n_n(n) \exp(-\frac{e\triangle V}{k_B T}) \tag{7}$$

При уменьшении потенциального барьера ток неосновных носителей заряда не меняется, а ток основных носителей заряда увеличивается в $\exp(\frac{e\triangle V}{k_BT})$ раз. Полный ток равен разности этих токов, т.е.

$$I(V_s) = I_0[\exp(\frac{eV_s}{k_B T}) - 1] \tag{8}$$

Формула правильно описывает полный ток (переносимый при равновесии как электронами, так и дырками), проходящий через (p-n)-переход. С увеличением V_s ток быстро возрастает.

С учётом формул (7) и (8):

$$I(V_s) = A \exp(-\frac{eV_s}{k_B T}) \left[\exp(\frac{eV_s}{k_B T}) - 1\right]$$
(9)

(сумма концентраций акцепторных и донорных примесей слабо зависиит от температуры и принимается за постоянную). При комнатных температурах $\frac{eV_s}{k_BT}\ll 1$, поэтому

$$I = A \exp(-\frac{e\triangle V}{k_B T}) \frac{eV_s}{k_B T} \tag{10}$$

Учитывая, что при небольших (порядка нескольких мВ) V_s ток прямо пропорционален напряжению, определяем сопротивление перехода:

$$R = \frac{V_s}{I} = \frac{k_B T}{e} \frac{1}{A} \exp(\frac{e\triangle V}{k_B T}). \tag{11}$$

Исследуя зависимость сопротивления перехода от температуры, найдём контактную разность потенциалов:

$$\Delta V = \frac{k_B}{e} \frac{\Delta(\ln R)}{\Delta(1/T)} \tag{12}$$

4 Экспериментальная установка

Схема установки, используемой для измерения температурной зависимости контактной разности потенциалов, изображена на рис. 6. Установка состоит из мостиковой схемы и термостата. Источником питания мостиковой схемы служат генератор прямоугольных импульсов. В качестве нулевого индикатора используется осциллограф. В плечи моста включены сопротивления $R_1=910~{\rm OM}$ и $R_2==9100~{\rm OM}$, магазин сопротивлений R_M и полупроводниковый диод (германиевый или кремниевый), сопротивление R_d которого подлежит измерению.

Сигнал с диагонали балансируемого моста подается на независимые усилители осциллографа: Канал I и Канал II. Разность этих сигналов видна на экране осциллографа. Осциллограф, генератор и одна из точек противоположной диагонали моста имеют общую Землю. Поэтому при сбалансированном (с помощью магазина R_M) мосте сигнал на экране осциллографа изображается в виде прямой линии (разность сигналов каналов I и II равна 0), и сопротивление R_d диода находится по формуле

$$R_d = (R_2/R_1)R_M = 10R_M. (13)$$

Измерения проводятся примерно через 5°C в интервале температур примерно от 25 до 80 °C. Для нагревания образца используется электронагреватель. Температура образца измеряется медно-константановой термопарой, один из спаев которой находится в тепловом контакте с диодом, а другой помещён в сосуд Дьюара, наполненный водой комнатной температуры.

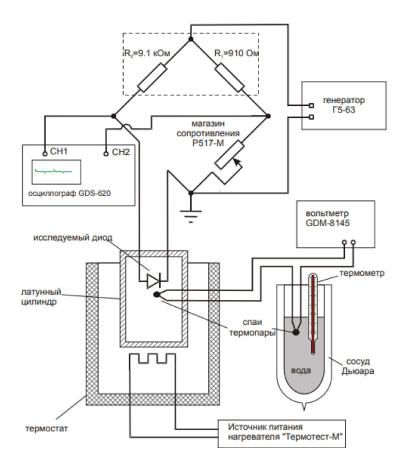


Рис. 6: Схема экспериментальной установки

5 Ход работы

- 1. Включим в сеть генератор, осциллограф, вольтметр (амплитуда сигнала генератора 10В с ослаблением в 2000 раз, период повторения 1000 мкс, длительность 600 мкс, временной сдвиг 25 мкс). Установим на осциллографе максимальную чувствительность (0,1 мВ/дел), подберём подходящую развертку.
- 2. Измерим температурную зависимость (p-n)-перехода. Для этого будем снимать зависимость разности потенциалов на термопаре (начальное значение -0.16 мВ, далее прибавляем ко всем значениям напряжения эту величину) от сопротивления диода (оно в 10 раз больше сопротивления магазина). Результаты занесём в таблицу 1. Значения температуры определим, зная постоянную термопары $(0.041 \text{ мB}/^{\circ}\text{C})$, переведём их далее в K.
- 3. Построим график зависимости величины $\ln R_d$ от обратной температуры (рис. 7). Определив угол наклона графика $(\frac{\triangle(\ln R)}{\triangle(1/T)} = 6656)$, оценим контактную разность потенциалов на границе (p-n)-перехода полупроводникового диода по формуле (12):

$$\Delta V = \frac{k_B}{e} \frac{\Delta(\ln R)}{\Delta(1/T)} = 0.574 mV \tag{14}$$

4. Различные оценки показывают, что для кремниевого диода $\Delta V = 0.35$ мВ, для германиевого диода от 0.2 мВ при небольшой концентрации носителей заряда до 0.5 мВ при большой концентрации носителей заряда. Полученное нами экспериментально значение $\Delta V = 0.574$ мВ совпадает по порядку величины с этими значениями.

 $\overline{V, MB}$ 0 0,08 0,18 0,26 0,37 0,47 0,55 0,63 0,77 0,87 0,98 ΔT , K 0 1,95 4,39 6,34 9,02 11,46 13,41 15,37 18,78 21,22 23,90 T, K 297 298,95 301,39 306,02 308,46 310,41 315,78 320,90 303,34 312,37 318,22 R_d, Ω 4000 3500 3000 2400 2000 1600 1400 1200 900 750 650 $\ln R$ 8,29 8,16 8,01 7,78 7,60 7,387,24 7,09 6,80 6,62 6,48 1/T, 3,37 3,35 3,32 3,30 3,27 3,24 3,22 3,20 3,17 3,14 3,12 $10^{-3}~{\rm K}^{-1}$ V, мВ 1,07 1,14 1.29 1,41 1,49 1,67 1,89 1.97 2,16 2,26 ΔT , K 27,80 34,39 36,34 40,73 46,10 52,68 55,12 26,10 31,46 48,05 T, K 323,10 324,80 328,46 331,39 333,34 337,73 343,10 345,05 349,68 352,12 R_d, Ω 600 520 400 340 300 250 200 180 140 120 $\ln R$ 6,40 5,99 5,83 5,30 4,79 6,25 5,70 5,52 5,19 4,94 3,10 1/T, 3,08 3,04 3,02 3,00 2,96 2,91 2,90 2,86 2,84 $10^{-3} \ \mathrm{K}^{-1}$

Таблица 1: Температурная зависимость сопротивления полупроводникового диода

6 Вывод

В ходе работы была экспериментально определена величина контактной разности потенциалов в полупроводниковом диоде путём определения зависимости сопротивления (p-n)-перехода от температуры. Полученное значение оказалось равным $\Delta V = 0.57$ мВ, что по порядку величины совпадает с различными оценками для контактной разности потенциалов в кремнии и германии.

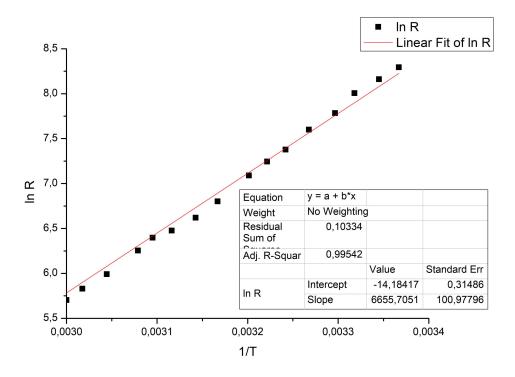


Рис. 7: Зависимость $\ln R_d$ от 1/T